

■ 행 사 ■

■ 제 2 회 운영위원회

- 일시 : 1992. 3. 19(목) 17:00
- 장소 : 럭키금성 역전빌딩 17층 회의실
- 참석인원 : 김대기 이사장 외 4명
- 회의안건 :
 - 업무진행 현황보고 및 전반기 업무 추진계획
 - 공기청정 연구조합 위원회 구성 및 운영계획

■ 제 2 회 편집위원회

- 일시 : 1992. 4. 14(화) 17:00
- 장소 : 럭키금성 마포빌딩 B1층 연구조합 사무실
- 참석인원 : 오명도 외 8명
- 회의안건 :
 - 기술지 발간에 대한 평가
 - 공기청정 기술지 제 2 집(클린증 시스템 및 시공) 원고 제목 선정
 - 기타

■ 연구개발사업 지원에 대한 설명회

- 일시 : 1992. 3. 30(월) 14:30~
- 장소 : 중소기업협동중앙회관 2층 소회의

실

- 참석인원 : 25명(조합원 업체)
- 설명회 내용 :
 - 공업기반기술개발사업 운영요령 및 기술개발(공발기금) 자금지원 (생기원 : 임창만 과장)
 - 특정연구개발사업 운영 요령 및 연구조합 관련 지원사업 (과기처 : 김상선 과장)
 - 연구조합사업에 대한 설명 (연구조합 : 차성일 사무장)

■ CLEANTECH ASIA '92전시회 및 중국관련 산업 방문

- 방문기간 : 1992. 4. 23(목)~1992. 4. 30 (목) (7박 8일)
- 참석인원 : 12명
- 방문일정 :
 - 4. 23~4. 25 : CLEANTECH ASIA '92 전시회 관람(싱가폴)
 - 4. 26~4. 27 : 중국에 대한 협작투자, 기술이전, 수출입관련 상담 및 산업체 견학(북경)
 - 4. 28~4. 29 : '92춘계중국출구상품 교역전시회 전람(광주)

■ 제3회 운영이사회 개최

- 일시 : 1992. 5. 21(목) 17:00~
- 장소 : 럭키금성역전빌딩 17층 회의실
- 참석 : 김대기 이사장외 5명
- 회의안건 :

- 클린룸 설문조사 결과 보고
- 클린룸 기술 세미나 개최에 따른
결과보고
- 퇴직금 지급 규정
- 클린룸 강습회 개최안
- 해외홍보용 카다록 제작사업 계획
안
- 일본오염제어 연구발표대회 내용
설명회 개최안
- 연구개발 사업 기술료 정수 계획안

■ 클린룸 기술 세미나 개최

- 일시 : 1992. 5. 12(화)
- 장소 : 한국종합전시장 본관 4층 소회의
실
- 참석인원 : 90명
- 세미나 내용 :

교 시	시 간	세 미 나 내 용	강 사	비 고
1	10:30~11:30	FILTER 신기술 및 현황	한국캠브리지필터(주) 공장장 김정호	
2	11:30~12:30	클린룸에 있어서의 에너 지 절감 대책	삼우종합건축사사무소 과장 이상인	
	12:30~13:30	점 심		
3	13:30~14:30	향후 클린룸 설계 및 시 공방법	삼성종합건설(주) 과장 임태빈	
	14:30~14:50	휴 식		
4	14:50~15:50	반도체산업과 클린룸 등 향	금성일렉트론(주) 부장 황태영	
5	15:50~16:50	클린룸 성능 평가와 유지 관리	럭키엔지니어링(주) 부장 장태준	

■ 정 보

■ G7프로젝트 추진 공청회

제조업 경쟁력 강화 등 당면문제 해결과
우리의 과학기술을 2천년대까지 선진 7개국

수준으로 발전시키겠다는 기본목표하에 관계부처합동으로 추진되는 G7프로젝트는 2천년대 주력산업이 될 국제경쟁력 보유가능 첨단제품을 선정하여 핵심 기술을 중점개발하는 초고집적반도체, 고선명TV, 전기자동차 등 7개 제품기술사업과 2001년까지 제품개발은 기대할 수 없으나 경제·사회발전과 삶의 질향상에 자력확보가 필요한 첨단소재, 환경, 차세대 원자로 등 7개 기반기술사업등 14개 대상사업을 작년 7월 선정하고, 이중에서 기추진중에 있는 고선명TV를 제외한 13개 사업에 대하여 작년말부터 금년 4월까지 연구기획을 완료하였다.

국내 산·학·연 전문가 1,100여명 미국, 일본, 유럽 등 외국전문가 49명의 참여와 과제별 공청회('92. 3~'92. 4)를 거쳐 작성된 연구기획의 내용은 사업별 최종목표 달성을 위한 핵심기술과제의 도출, 연구개발방법제시, 추진체제, 소요연구비 및 인력규모 산출, 산업화 연계계획은 전 주기에 걸친 계획을 포함하고 있다.

연구기획결과에 의한 G7프로젝트의 연구개발투자 총소요액은 약 4조원 규모로서(공공부문 2조4천억원, 민간부문 1조6천억원) '92년에 약 2천억원(민간부문 900억원 포함) '93년에 약 3,800억원(민간부문 1,200억원)의 투자규모에 제시하고 있으며, 투입인력 규모는 총 75,000여명으로 년평균 7,500여명의 연구인력이 필요한 것으로 추정되었다.

각 사업별 목표달성을 위하여 반드시 확보해야 하는 핵심기술로는 약 450여개의 과제가 도출되었는데 이중 106개 과제는 국제공동연구 또는 외국의 전문가 활용이 불가피한 것으로 조사되었으며, 14개 과제는 기술도입, 24개 과제는 국내 연구원의 해외파견·훈련

을 통한 기술습득이 바람직한 것으로 제시되는 등 전체과제 중 144개 과제(약 32%)가 선진국과의 협력이 필요한 것으로 나타났으며, 국제협력의 대상을 국가별로 보면 미국이 49과제, 일본이 27과제, EC가 20과제 독립국가연합 등 기타 국가가 10과제 등이다.

정부는 지금까지의 연구기획결과를 토대로 연구기획의 내용과 우리의 투자능력, 인력수준 등 제반여건을 감안하여 14개 프로젝트 중 우선추진하게 될 대상사업을 확정한 후, 5월중 추진대상사업별 연구개발추진계획을 신문에 공고하게 되며, 사업 추진기관 선정 방식에 있어서도 국·내외 모든 연구원에 참여신청을 개방하여 실력있는 연구원이 사업에 참여할 수 있도록 할 것이다.

이를 위하여 금번 연구기획에서는 세부과제별 구체적 목표 및 연구내용, 연구비 규모, 연구기관(연구책임자)자격, 과제선정 및 평가기준 등 과제별 제안요구서(REP)를 작성하였으며, 특히 소요연구개발비에 대한 정부 및 민간의 부담비율을 사전에 명시함으로써, 사업추진시 최종수요자인 기업의 적극적인 참여유도와, 기업의 의사를 적극 반영할 수 있도록 하였다.

과학기술에 대한 선진각국의 경쟁이 날로 치열해지고, 연구개발에 국가지원을 규제하자는 움직임까지 제기되고 있는 치열한 국제환경속에서 금번 착수하게 되는 G7프로젝트를 통하여 과학기술선진국 진입이라는 소기의 목적을 달성키 위하여는 한정된 국가연구지원의 결집으로 국가목표에 부응한 연구개발과 선진국과의 적극적인 기술협력을 강화해 나가는 한편, 새로운 OECD의 New Rule of Game이나 선진국의 R & D개발 요구, GATT체제하에서의 불공정거래행위규제등 국제여

전변화를 감안하여 추진대상과제 및 추진방법을 관계부처 협의하에 면밀히 검토해 나갈 계획이다.

G7프로젝트 공청회 개최일정

과 제 목 록		일 시	장 소	주 관	담당조정관실
G7 제 품 기 술 개 발 사 업	① 초고집적 반도체개발	'92. 4. 27	반도체연구조합 회의실	반도체연구조합	전자
	② 광대역 ISDN개발	'92. 4. 3	한국통신 연구개발센타	한국통신	전자
	③ 고선명TV(HDTV)개발	—	—	(기)추진사업	전자
	④ 전기자동차 개발	'92. 4. 21	여의도 중소 기업회관	자동차부품 종합기술(연)	기계
	⑤ 인공지능컴퓨터개발	'92. 4. 14	과기원(홍릉)	컴퓨터연구조합	전자
	⑥ 신의약·신농약개발	'92. 4. 27	과기원(홍릉)	신약연구조합	화공
	⑦ 첨단생산시스템개발	'92. 4. 27	교육문화회관	생산기술연구원	기계
G7 기 반 기 술 재 발 사 업	① 정보·전자·에너지 첨단 소재 기술개발	'92. 3. 9	한국종합전시장	서울대 신소재(연)	화공
	② 차세대 수송기계·부품기 술개발	'92. 4. 20	서울대 문화관소강당	서울대	기계
	③ 신기능 생물소재 기술개 발	'92. 2. 14	전경련회관	유전공학연구 조합	생물해양
	④ 환경공학 기술개발	'92. 4. 22	환경연구원	환경연구원, KAIST 공동	생물해양
	⑤ 신에너지 기술개발	'92. 4. 28	대전리베라호텔	한전기술(연)	동력자원
	⑥ 차세대원자로 기술	'92. 4. 20	대전리베라호텔	한전기술(연)	원자력
	⑦ 감성공학 기술개발	'92. 4. 9	무역회관	표준(연)	기계

전자전기 내년 기술개발 자금 대폭 증액

상공부는 전자전기산업의 구조고도화를 촉진, 국제경쟁력을 제고하기 위해 내년도 기술개발지원자금을 올해의 10배에 가까운 1천1백여억원으로 증액키로 했다.

5월 4일 관계당국에 따르면 상공부는 내년에 전자핵심기술 및 부품개발사업(일렉트로-21 프로젝트)을 비롯해 대형컴퓨터 개발,

이동통신 단말기 및 부품개발, CATV기기 및 부품개발 등 대형신규개발사업의 본격 추진을 위해 이같이 전자전기분야에 대한 기술개발 지원자금을 대폭 증액키로 하고 이를 내년도 예산에 반영해 주도록 최근 경제기획원에 요청했다.

상공부가 요청한 내년도 대형신규과제에 대한 예산지원액은 △전자핵심 기술 및 부품

개발 7백 33억5천만원 △대형컴퓨터 개발 30억원 △이동통신단말기 및 부품개발 50억원 △CATV기기 및 부품개발 50억원 등 총 8백 63억5천만원에 달하고 있다.

또 계속사업과제에 대한 내년도 예산지원 요청액은 △HDTV 1백억원 △차세대기억소자(2백56MD램) 1백54억원 △G4 FAX 20억원 △고속중형컴퓨터 5억원 △배전자동화시스템 3억원 등이다.

상공부는 이와 함께 전자전기분야 기술개발사업의 원활한 추진과 정보화의 촉진을 위해 3개 산하기관에 대한 내년도 예산도 올해의 4배에 가까운 2백20여억원을 배정키로 했는데 이를 기관별로 보면 △전자부품종합기술연구소 1백1억2천8백만원 △산업기술정보원 1백15억4천8백만원 △정보기술연구원 12억7백만원 등이다.

■ 「기술혁신연구센터」 설립

교수·학생의 연구결과를 토대로 기업체와 협동으로 생산현장에 적용된 기술을 개발하기 위한 가칭 기술혁신연구센터(TIC : Technology Innovation Center)가 설립된다.

한국과학기술원(KAIST원장 千性淳)은 科技大인근에 부지 1만1천평, 건평 3천3백평 규모의 가칭 기술혁신연구센터를 설립키로 하고 최근 千性淳원장을 위원장으로 한 TIC설립추진위원회를 구성했다.

KAIST의 교수·학생 등 연구인력의 연구성과를 응용, 기업체에 이전시켜 수출산업화를 유도하기 위해 설립되는 이센터의 부지와 기술개발은 KAIST가 맡고 건설은 기술개발을 원하는 관련기업에서 부담하게 된다.

이 센터가 설립되면 產·學·研협동연구를 통해 기업의 국제경쟁력제고와 함께 연구성과를 기초로 한 신기술의 기업화를 촉진시킬 것으로 기대된다.

■ 조합원사 동정 ■

■ 삼성엔지니어링

이란에 대규모 유화플랜트 수출

三星엔지니어링(대표 安德基)은 이란 타브리즈석유화학社(TPC)가 발주한 합성고무원료생산공장 건설공사를 1억8백만달러에 따냈다.

5월 12일 三星은 이란국영TPC社와 연산 5만7천t규모의 공장을 건설키로 5월 11일 하오(현지시간)이란 테헤란에서 계약을 맺었다

고 밝혔다.

터키와의 접경지대인 타브리즈 석유화학공단안에 세워질 이공장은 오는 94년 말 완공되며 부타디엔을 연간 1만7천t, 스티렌부타디엔고무(SBR) 2만5천t, 스티렌 부타디엔라텍스(SBL) 1만7천t 규모를 생산한다.

이번 석유화학 플랜트수출은 三星엔지니어링이 설계 및 감리를, 錦湖石油化學이 공정기술을, 三星物產이 금융을 각각 맡아 설계 및 공정 기자재공급 자금지원등이 패키지화된

선진국형 수출로 회사측은 순수국내기술로는 가장 큰 규모라고 밝혔다.

사무실 이전

삼성엔지니어링(주)은 5월 26일부로 다음과 같이 사무실을 이전하였습니다.

■ 삼성종합건설

국내 첫 협력사 공모

삼성종합건설이 국내에서 처음으로 실시한 협력업체 공모에서 모두 1천2백40개社가 신청, 높은 호응도를 보였다.

5월 27일 삼성종합건설에 따르면 5월 14일부터 1주일동안 각 업체들로부터 접수를 받은 결과 기존등록사 5백5개社외에 7백35개社가 신규로 등록원을 제출했다. 신규로 등록원을 낸 협력업체를 부문별로 보면 건축부문이 3백7개社로 가장 많고 설비부문 1백15개社, 토목부문 1백3개社, 전기부문 74개社, 플랜트부문 48개社 등이다.

삼성종건은 신청업체에 대해 오는 6월 20일까지 심사를 한 후 6월말 협력업체를 최종 확정할 방침이다.

■ (주) 영 엔지니어링

사무실 이전

(주)영 엔지니어링은 5월 13일부로 다음과 같이 사무실을 이전하였습니다.

구 分	변 경 전	변 경 후
주 소	영등포구 당산동 2가 30-2 (영등포 유통상가 2층 25열 14)	마포구 서교동 396-36
전화번호	(02)675-0763~4	(02)326-0762
FAX번호	(02)672-1262	(02)326-0761

■ 삼성엔지니어링(주)

구 分	변 경 전	변 경 후
주 소	종로구 세종로 211-1(광화문B/D · 5~10)	송파구 가락동 79-2(그린B/D)
전화번호	(02)399-3595	(02)405-3322, 3114
FAX번호	(02)399-3707	(02)405-3300

■ 삼우내장건설(주)

상호변경 및 사무실 이전

삼우내장건설(주)는 6월 1일부로 상호가 변경됨과 동시에 사무실이전을 하였습니다.

구 分	변 경 전	변 경 후
상 호	삼우내장건설(주)	(주)삼우내외산업
대표이사	정 규 수	변경전과 동일함
주 소	종로구 연지동 1-24(원석B/D)	종로구 인의동 28-2 (삼우B/D 3층)
전화번호	(02)763-8131	변경전과 동일함
FAX번호	(02)745-8207	

■ 한양엔지니어링(주)

전화번호 및 FAX번호 변경

한양엔지니어링(주)의 전화번호 및 FAX번호가 6월 12일부로 변경되었습니다. 주소는 종전과 동일하다

구 分	변 경 전	변 경 후
전화번호	(0331)211-1071~8	(0331)214-0141~9
FAX번호	(0331)211-1079	(0331)214-0140

■ 국내외 관련 전시회 및 세미나 개최안내 ■

■ "THE FUTURE PRACTICE OF CONTAMINATION CONTROL"

In London on 21st to 25th September 1992 at the
Queen Elizabeth II Conference Centre

TUTORIALS

Computer modeling, Health & Safety, Certifying Cleanrooms
Class I and SMIF type cleanrooms, CFC Alternatives

MAJOR DISCUSSION-FORUM SESSIONS

Standards, Microelectronics, Healthcare Manufacturing
Food and Beverage Production

CASE STUDIES

Pharmaceutical, Microelectronics, Food, Isolation Technology, Training

19 FULL CONFERENCE SESSIONS

Cleanroom Facility Design, Metrology & Analysis of Water
Precision Part Assembly, Isolation Technology *(E)
Personnel Management & Operations, Airborne Contamination *(G)
Isolation Technology *(M), Surface Contamination
Ultra Pure Water, Standards & Practices
Total Quality Management, Training, Airborne Contamination *(F)
Facility Design *(F), Ultra-pure Gases & Chemical, Instrumentation and Monitoring
Health & Safety, Garment Properties & Design
Garment Management and Maintenance, Cleanroom Cleaning
* (E) = Microelectronics (H) = Healthcare Manufacturing (F) = Food



International Committee of Contamination Control Societies

Host; Society of Environmental Engineers

SEE Secretariat; Owles Hall, Buntingford, Herts, SG9 9PL. Tel: 0763 71209 Fax: 0763 73255



Aerosol and Particle Measurement

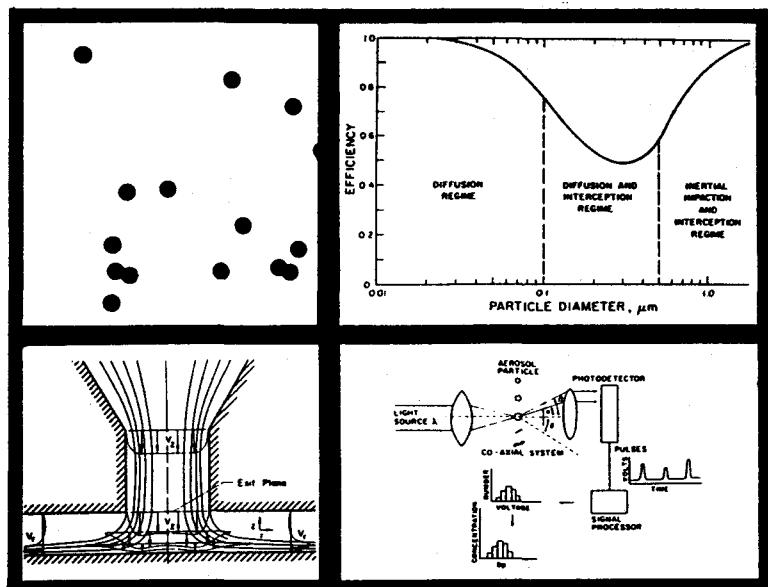
17th Offering

Measurement of Particles for:

- Clean Room and Contamination Control
- Air Quality and Stack Emission
- Industrial Hygiene

August 24-26, 1992

Radisson Metrodome Hotel, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota



Sponsored by:

**Particle Technology Laboratory
Department of Mechanical Engineering
Institute of Technology
UNIVERSITY OF MINNESOTA**

In cooperation with TSI, Incorporated

■ MICROCONTAMINATION Exposition

c/o Canon Communications, Inc.
3340 Ocean Park Blvd., Suite 1000
Santa Monica, CA 90405-3216



EXPOSITION: OCTOBER 28-29
CONFERENCE: OCTOBER 27-30
SANTA CLARA CONVENTION CENTER
SANTA CLARA, CALIFORNIA

SPONSORED BY MICROCONTAMINATION MAGAZINE

FROM CLEAN TO ULTRACLEAN — AND EVERY CLASS LEVEL IN BETWEEN.

My company shares something in common with MICROCONTAMINATION 92—we both offer something different from others in the industry. The quality technical professionals attending the show deserve to see the advantages of our products. How do we sign up?

YES, I WANT TO SHOWCASE MY PRODUCTS TO THE CLASSES.

- Send me information about exhibiting at MICROCONTAMINATION 92.
- Send me information about attending the conferences.
 - MICROCONTAMINATION 92 Conference
 - Cleanroom Technology Forum

Name _____ Title _____

Company Name _____

Address _____

City _____ State _____ Zip _____

Phone _____ Fax _____

BA

YES, I WANT TO SHOWCASE MY PRODUCTS TO THE CLASSES.

- Send me information about exhibiting at MICROCONTAMINATION 92.
- Send me information about attending the conferences.
 - MICROCONTAMINATION 92 Conference
 - Cleanroom Technology Forum

Name _____ Title _____

Company Name _____

Address _____

City _____ State _____ Zip _____

Phone _____ Fax _____

■ 근착 해외도서 목차안내 ■

■ クリーンテクノロジー

Clean Technology

VOL.2 NO.1

■特集 半導体清浄技術最前線

- シリコンウェハー洗浄技術の課題と展望／ソニー 服部 毅 11
- 半導体製造における清浄化技術／松下電子工業 米田健司 17
- 最近のクリーンルームにおける環境制御について／竹中工務店 呂 俊民 21
- メガビット時代の不良解析技術／日本電気 御子柴啓明 26
- クリーンルーム内の空気イオンの効果／テクノ菱和 鈴木政典 31

■特集 室内空気複合汚染防止と空調設備

- 最近の室内空気の現状／東京女子医科大学 香川 順 40
- 最近の室内空気環境汚染とビル管理法／国立公衆衛生院 池田耕一 43
- 微生物粒子の挙動と真菌、細菌の室内濃度への影響／郡山女子大学 菅原文子 50
- 汚染物質及び発生源と対策／東京都杉並区西保健所 村松 學 55

■連載

- クリーンルーム技術の基礎⑦／高砂熱学 技術部 59

■製品紹介

- ポータブルカウンターMODEL-300・500シリーズ／大和製作所 藤田敏男 63
- 奥付／広告掲載会社一覧 66

VOL.2 NO.2

■特集 超純水配管材料

- 超純水配管材／栗田工業 本村敬人 11
- 超純水配管のバルブ／野村マイクロサイエンス 阿部 翔 15
- 超純水配管のポンプ／二国機械工業 佐藤六平次 20
- 超純水管路用分岐ダイヤフラムバルブ／積水化学工業 真壁日史郎 25

- 半導体工場の廃水処理／オルガノ 桐生草平 28

- 半導体製造プロセス薬品用フィルター／日東電工 大野文雄 36

- 気密漏れ自動検査装置／大塚技研工業 石田元宏 38

○ライブボール（非滞留ボールバルブの開発）／旭有機材工業 横山郁生	40
○半導体用超高純度ガス供給系エクセルクリーンパイプ／神戸製鋼所 門永敏樹	46
○微風速計よ測定器たれ①／テクノ菱和 鈴木国夫	51
■連載	
○クリーンルーム技術の基礎⑧／高砂熱学 技術部	55
●奥付／広告掲載会社一覧	58

VOL.2 NO.3

■特集：アメニティ

○クリーンルームのアメニティ対応／鹿島建設 望月 明	11
○クリーンルームの作業環境の評価／大成建設 深尾 仁・森 直樹	17
○緑化によるアメニティ創出／東京農業大学 近藤三雄	24
○植物によるアメニティの創出／愛媛大学 仁科弘重・浅海英記・橋本 康	29
○環境音楽によるアメニティの創造／情緒科学研究所 渡辺茂夫	33
 ○たばこ煙と室内換気／日本たばこ産業 石津嘉明	39
○クリーン化技術の現状と空気圧機器の課題／三菱電機 園田信夫	43
○リンク式ウェハ搬送ロボット／メックス 岩口四郎	50
○微風速計よ測定器たれ②／テクノ菱和 鈴木国男	54
●奥付／広告掲載会社一覧	58

VOL.2 NO.4

■特集：大気環境

○地球大気中におけるフロンなど微量成分気体の分布と動態 ／東京大学 富永 健	11
○大気浮遊粉塵中の鉄の状態分析／東京工業大学 松尾基之・小林孝彰	15
○成層圏エアロゾルの測定／東京理科大学 中江 茂	19
○大気中のエアロゾルのイオン成分／埼玉大学 坂本和彦	24
 ○レーザ光源利用の粒子径計測法の課題／群馬大学 中山満茂	29
○建築設備機器の低騒音化／荏原製作所 工藤信之	35
○ビル管理におけるレジオネラ症予防対策／厚生省 上田博三	40
○半導体ガス用パーティクルカウンタ／リオン 水野真人	44
■製品紹介	
○低電圧殺菌方式の家庭用浄水器について／INAX 高木 繁	53
■連載	
○クリーンルーム技術の基礎⑨／高砂熱学工業 技術部	55
●奥付／広告掲載会社一覧	58

MICROCONTAMINATION

THE MAGAZINE FOR ULTRACLEAN MANUFACTURING TECHNOLOGY

APRIL 1992

VOLUME 10 NUMBER 4

21

PROCESS CLEANLINESS

Vapor-phase-etching technology: Exploring surface sensitivities and uniform oxide etching

An in situ air-transported condensable contamination removal technique is examined.

Glenn L. Nobinger, Darrell J. Moskowitz, and Wilbur C. Krusell

29

ANALYTICAL TECHNOLOGIES

Analyzing nonvolatile residue using aerosol formation and measurement

Sensitivity of new spray-droplet approach reaches parts-per-billion levels.

Douglas W. Cooper

37

ULTRAPURE FLUIDS

Evaluating point-of-use membrane filters under pulsed-flow conditions

Tests can be used to compare performance of similarly rated filters.

P. John Lloyd and Jim M. Bentley

43

CLEANROOM MANAGEMENT FORUM

Solving the quality-versus-cost dilemma in cleanroom garment acquisition

Whether to buy disposables, rent reusables, or buy or lease reusables, that is the question.

Bob Sloan

9 Editor's page

10 Industry news

- Sematech watch:

Contamination point man—

A talk with Eugene Feit

- SEMI symposium: Ultraclean concerns top industry list

- Contractor's work

shusses along

- IES meeting: Tech sessions,

NASA to share ATM stage

- Briefly speaking ...

48 Product technology news

- Brooks' MFC boasts cleaner materials, better surface finish
- Wilden PFA Teflon pump features reduced contamination
- What's new, who's hot
- Products

60 Spotlight: Cleanroom gloves

70 Classifieds

70 Ad index

■ 空気清浄

第29卷 第4号

目 次

特集 労働環境

「作業環境測定結果の評価について」の特集にあたって.....	三 上 辰 雄…1
粉じん測定機器の労働省基準局長指定機関による定期的較正制度について.....	田 中 辰 雄…2
作業環境測定及びその結果の評価.....	後 藤 博 俊…10
気中粉じん濃度測定結果の評価方法について.....	木 村 菊 二…20
気中ガス・蒸気濃度測定結果の評価と留意点について.....	木 村 二 郎…26
地下工事における換気技術指針の改訂について.....	三 上 辰 雄…40
感染性ウィルスによる生物学的障害に対するエアフィルタシステムの安全性能.....	井 上 互・他…52
電石不織布製エアフィルタのウィルス捕捉能.....	中 村 みさ子・他…61
会 報・他.....	66

第29卷 第5号

目 次

年頭の挨拶.....	藤 井 正 一…1
可視化画像処理を用いて低風速一方向流中のロボットによる気流の乱れの解析.....	岩瀬 和 夫・他…2
小型エアコンディショナー用脱臭フィルタの開発.....	桜 井 享・他…10
スピンドライヤー乾燥におけるウェハ帯電の防止.....	稻 葉 仁・他…16
イオナイザ用セラミック電極.....	岡 野 一 雄…24
スーパークリーンルーム用イオナイザの開発.....	阪 田 総一郎・他…31
レーザーパーティクルカウンタ24台の比較試験.....	片 桐 拓 朗・他…40
クリーンルーム計測ロボット.....	呂 俊 民・他…48
米国の大気清浄法改正について.....	A・スコット・ウォーヒーズ…58
世界に類なき空気神社の建立を見て.....	塩 入 宗 弘…63
会 報.....	68

第29卷 第6号

目 次

クリーンルームにおける清浄化指針(案).....	クリーンルームにおける清浄化指針専門委員会…2
0.1 μm ULSIプロセス環境における清浄度管理.....	斎 木 篤…35
無発じん空気イオン化システムの開発.....	鈴 木 政 典・他…40
HEPAフィルタ直下における乱流の数値解析.....	誠 訪 好 英・他…52
クリーンルームの作業環境の改善に関する研究.....	深 尾 仁・他…59
クリーンルームにおけるイオン発生特性.....	森 直 樹・他…71
エアロゾルヴィジュアルの掲載にあたって.....	山 下 憲 一…76
第29卷目次.....	79
会 報・他.....	81

■ 第11回空気清浄とコンタミネーションコントロール研究大会

プロ グ ラ ム

第1日 平成4年4月21日(火)A会場(大講堂)

10:00~10:20	開会挨拶	会長 藤井正一
10:20~12:20	一般講演	座長 浅田敏勝(日本IBM㈱)、江見 準(金沢大学)
A-1	サブミクロンエアロゾル粒子の乱流および遷移域流れにおける拡散沈着	1
	Diffusive Deposition of Submicron Aerosol Particles in Turbulent and Transitional Flow	
	○島田 学、奥山喜久夫(広島大学)	
A-2	微量放射線源による蒸気およびガスのクラスター化	5
	Formation of Clusters from Vapor and Gas by Radioactive Source	
	○奥山喜久夫、足立元明(広島大学)	
A-3	クリーンルーム空気中でのnmサイズ粒子生成に関する研究	9
	Study of Ultrafine Particle Generation in Clean Room	
	○井上正憲、白井琢也、吉田隆紀、岡田孝夫(高砂熱学工業㈱)	
A-4	ラドン及びその壊変核種間の放射能平衡比の変動特性	15
	Radioactive Equilibrium between Radon and its short-lived daughters	
	○中江 茂、藤原茂樹、三浦和彦(東京理科大学)	
A-5	エアロゾルの光吸収特性の試験研究	19
	Light Absorption by Aerosols	
	○中江 茂、橋詰幸郎、三浦和彦(東京理科大学)	
A-6	SiO ₂ 粉末のエjectorによる分散	23
	Dispersion of SiO ₂ Powder by an ejector	
	○金剛千嘉男、杉山修司(金沢大学)	
12:20~13:00	休憩	
13:00~14:00	招待講演	座長 今川八束(麻布大学)
	環境とウイルス	27
	Virus and Environment	
	日野茂男(鳥取大学医学部ウィルス教室教授)	
14:00~14:10	休憩	
14:10~15:30	一般講演	座長 奥山喜久夫(広島大学)、佐藤宇昭(㈱大気社)
A-7	フィルタ後方における微粒子の乱流拡散の数値解析	31
	A Numerical Study on Particulate Turbulent Diffusion behind Pleated Air Filters	
	○諏訪好英、柳澤寛高、西村哲郎(㈱東芝)、藤井修二、湯浅和博(東京工業大学)	
A-8	自動搬送車まわりの気流解析(その2)	35
	A Computer Aided Analysis of Air Flow around an AGV (Part 2)	
	○寿上宏司、金山 寛(富士ファコム制御㈱)、横幕博行、松浦基雄、高橋武男(富士電機㈱)	
A-9	HEPAフィルタ後流における乱流特性と粒子拡散	37
	Airflow Turbulence and Particle Diffusion behind HEPA Filter	
	○藤井修二、湯浅和博、荒井安行、大東信之、石崎陽児(東京工業大学)、諏訪好英、柳澤寛高(㈱東芝)	

A-10	二次元流速分布の定量可視化法	43
	Quantitative Visualization of Two Dimensional Velocity Components in Flow	
○	清水 熟、水谷成寿、広瀬孝一、秋野詔夫 (茨城工業高等専門学校)	
15:30~15:40	休憩	
15:40~17:20	一般講演 座長 岡田孝夫 (高砂熱学工業株)、清水 熟 (茨城工業高等専門学校)	
A-11	クリーンルーム内の微粒子の挙動解析	47
	Analysis of Behavior of Fine Particles in Clean Room	
○	齊藤正信、森岡宏次 (株大気社)	
A-12	可視化画像処理によるクリーンルームの気流解析	51
	その3. 一方向流中の動作発熱体による気流の乱れ	
	Image Processing of Visualized Air Flow for Cleanroom Design	
	(Part 3) Analysis of Unidirectional Air Flow Disturbed by a Heated Moving Obstacle	
○	大谷光幸、岩瀬和夫、岡崎俊春 (三建設工業株)	
A-13	画像処理による温度コントロール精度及び温度分布特性の解析と改善	57
	Analysis of temperature controlled accuracy and distribution by image processing	
○	大重一義、関根賢二、岡本欣也、岡本 守 (日本エアーテック株)	
A-14	ライン式クリーンルームにおける気流分布	61
	Airflow Distribution in a Line Type Clean Room System	
○	藤田 勉、末田 明、浦 等、木村正夫 (川崎製鉄株)、大沢 操 (平山設備株)、早川一也 (日本工業大学)	
A-15	自然換気を行う大規模卸売市場における環境実測	65
	Ventilation Characteristics in Large Scale Market Building by means of Field Experiments	
○	出口清孝 (法政大学)、村上周三、加藤信介、高橋岳生 (東大生産技術研究所)	

第1日 平成4年4月21日(火)B会場(801)

10:20~11:40	一般講演 座長 西岡利晃 (株大林組)、植田加久夫 (新菱冷熱工業株)	
B-1	クリーンルーム床面の清掃方法に関する研究	71
	Studies on the floor cleaning in clean rooms	
○	竹迫清之 (アマノ株)、晴波 満 (株北関東シーアイシー研)、山崎省二 (国立公衆衛生院)	
B-2	クリーンルームの作業環境の改善研究	75
	その2. 稼動クリーンルーム内作業者の心理・生理量の実態把握	
	Study on Improvement of Work Environment in Clean Room	
	Part 2. Fact Finding Survey on Mental Physical Values Workers in Clean Room under Operation	
○	深尾 仁、梅主洋一郎、佐川祐一郎、大井 亨、森 直樹 (大成建設株)、近藤 久、松尾剛伸 (東京エレクトロン株)	
B-3	オゾンによるエタンチオールの気相酸化	79
	Oxidation of Ethanethiol by Ozone in Gaseous Phase	
○	鈴木 昇、野口雅子、北条慎恵、飯村兼一、宇津木弘 (宇都宮大学)、飯島一浩 (株朝日工業社)	
B-4	LSIプロセスにおけるウェハ破損の検出	81
	Detection of Breaking Wafer in LSI Process	
○	浅野 勝 (ダン産業株)	

11:40~13:00 休憩

14:10~15:30 一般講演	座長 南野 倭 (芝浦工業大学)、金岡千嘉男 (金沢大学)
B-5	床清掃によるビニールタイルからのアスベスト発生について 83 Asbestos Generation from Vinyl Tile by Floor Maintenance Procedures ○鈴木 稔 (株間組)、入江建久 (国立公衆衛生院)、劉 瑞 (新日本空調㈱)、正田浩三、工藤恭丈 (東京美装興業㈱)、高木 耕 (株大京觀光)
B-6	一般環境における粉じんの粒度分布についておよび制御に関する研究 85 Study on the Behavior and Control of the Size Distribution of Particles in Non-occupational Environment ○劉 瑞 (新日本空調㈱)、入江建久、池田耕一 (国立公衆衛生院)、吉沢 晋 (東京理科大学)、猪股亜二郎 (東山興業㈱)
B-7	居住環境におけるアレルゲンの挙動に関する研究 (その9) 91 夏期、秋期にわたる生ダニ、ダニタンパクの消長 Study on the Behavior of Allergens in Indoor Environment (Part 9) The Change of Living Mites and Mite Allergens from Summer to Autumn ○飯森沢喜 (旭化成ホームズ㈱)、入江建久、阪口雅弘、(国立公衆衛生院)、河口知生 (大和ハウス工業㈱)、黒田直子 (清水建設㈱)
B-8	加湿器から空中への細菌飛散の制御 95 Control of microbe disperse from humidifier to the humidified air ○山崎省二、上村 裕、木村昌伸 (国立公衆衛生院)、竹下 節、角屋信治、Jan Wethergard、伊藤秀樹 (ムンタース㈱)
15:30~15:40	休憩
15:40~17:40 一般講演	座長 入江建久 (国立公衆衛生院)、森永新一郎 (三機工業㈱)
B-9	植物による室内空気浄化に関する研究 99 Study on the Role of Vegetation as Sink of Indoor Air Pollution ○福井正紘、石黒 武、呂 俊民 (株竹中工務店)
B-10	室内気流のラドン娘核種の挙動に与える影響に関する実験的検討 (その2) 103 Experimental Study on the Effects of Indoor Air Flow on Radon Progeny Behaviors II ○池田耕一
B-11	拡散型サンプラーを用いた室内空気中のパラジクロロベンゼンの個人モニタリング法 107 Personal monitoring method of p-dichlorobenzene in indoor air by using diffusion sampler ○川田 浩 (モルテン㈱)、松村年郎 (国立衛生試験所)
B-12	床面からの粉じんの挙動 109 Behavior of Particles Generated from Floor ○麻生典昭 (高砂熱学工業㈱)、湯懐鶴、吉澤 晋 (東京理科大学)
B-13	空中浮遊菌と浮遊粒子の関係 113 Relation of Airborne Microbiological Particles ○北谷充由、鶴飼 浩、堀口 勉、湯懐鶴、吉澤 晋 (東京理科大学)
B-14	沿面放電プラズマを利用した空気浄化装置—SPCPエアピュリファイヤ 117 Integrated Air Purifier Using Surface Discharge Induced Plasma Chemical Process ○増田尚一 (福井工業大学)、屠詳令 (屠詳令研究所)

第1日 平成4年4月21日(火)C会場(904)

10:20~12:00	一般講演	座長 藤井修二 (東京工業大学)、木内一秀 (NTT LSI研究所)
C-1	クリーンストッカーの空気清浄度性能評価	121 Air Cleanliness Evaluation of Clean Stocker ○鈴木良延、小林重雄、原田博司 (清水建設㈱)
C-2	多目的空気清浄器の開発	125 Development of Multi-objective Air Purifier ○坂本和彦、小林政一、太田 裕、君島克憲、奥山正喜 (埼玉大学)
C-3	小型室内空気清浄器についての浄化性能に関する研究 (その3) 脱臭性能試験方法及び試験結果	127 Studies on Air Cleaning of Air Cleaners Part 3. Testing Method for deodorization Efficiency and experimental results ○水野則康、南野 倩、秋元寿里、安藤圭吾 (芝浦工業大学)
C-4	一般空調用空気净化装置の粉じん除去性能について (その4) ASHRAE st.52-76による静電式中性能フィルタの試験結果	131 On the Efficiency of Air Filters for the Air Conditioning Facilities Part 4. Results of Efficiency Test of Medium Efficiency Electret Filters by ASHRAE st.52-76 ○御子貝康子、南野 倩、三関 元、堂前純一 (芝浦工業大学)
C-5	一般空調用空気净化装置の粉じん除去性能について (その5) 中性能フィルタの試験方法の再検討	135 On the Efficiency of air Filter for the Air Conditioning Facilities Part 5. Restudying on Testing Method of General Filter ○三関 元、南野 倩、御子貝康子、加藤博孝、藤江真也 (芝浦工業大学)
12:00~13:00	休憩	
14:10~15:30	一般講演	座長 川又 亨 (日本エアーテック㈱)、本間克典 (産業医学総合研究所)
C-6	垂直整流形クリーンルームの気流の均一性に関する研究	137 Uniformity of Air Velocity Distribution in Unidirectional Flow Cleanrooms ○西岡利晃、渥美勝利、謝 国平 (㈱大林組)
C-7	高性能スポットクリーンフード	141 High Performance Spot Clean Hood ○藤田明広、上村康夫 (㈱ダン科学)
C-8	クリーンルームにおける浮遊微粒子濃度分布の移動測定	145 Moving Measurements of Particle Concentration Distributions in Cleanrooms ○藤井修二、湯浅和博、荒井安行、大東信之、石崎陽児 (東京工業大学)
C-9	安全キャビネットの微生物学的性能に関する検討	149 Investigation on Biological Performance of Safety Cabinet ○木真吾、深見 哲、佐藤勝也 (㈱日立製作所)
15:30~15:40	休憩	
15:40~17:40	一般講演	座長 向阪保雄 (大阪府立大学)、池沢芳夫 (日本原子力研究所)
C-10	エレクトレットHEPAフィルタの開発	153 Development of Electret HEPA Filter ○谷 八紘、高瀬 敏 (東洋紡績㈱)

C - 11	高純度ガス用金属繊維製フィルタの高流束下での除粒子性能 Removal Efficiency at High Face-Velocity of Sintered - Fiber Filter for High Purity Gases	157
	○佐藤賢一 (日本ポール株)	
C - 12	メンブレンフィルタの集じん性能の推定 Prediction of Membrane Filter Collection Performance Filters	161
	○大谷吉生、江見 準、水谷 洋、森 治朔 (金沢大学)	
C - 13	ウェハに及ぼす有害ガス除去フィルタの検討 (第2報) Performance test of absorbers to trap harmful gases to silicone wafer (Part II)	165
	○古沢 孝、高橋和宏、岩崎信夫 (日本無機株)	
C - 14	JPDR解体作業時のアークソー切断時に発生するエアロゾルの特性 Characteristics of aerosol generated at arc saw cutting in JPDR decommissioning	169
	○池沢芳夫、西薙竜也、中村 力 (日本原子力研究所)	
C - 15	放射性じん埃の再浮遊評価の諸問題 Some Problems on Estimation of resuspension of radioactive aerosol	173
	○西薙竜也、中村 力、池沢芳夫 (日本原子力研究所)	

[第2日 平成4年4月22日㈬ A会場(大講堂)]

10:00~11:00	招待講演 座長 横地 明 (東海大学) 精密洗浄技術 Technology of Precision Cleaning	177
	○角田光雄 (東京家政学院大学教授)	
11:00~11:10	休憩	
11:10~12:10	一般講演 座長 中江 茂 (東京理科大学)、鈴木道夫 (日立プラント建設株)	
A - 16	微細粒子水用連続ろ過装置 Automatic Submicron Particles Removal Liquid Filter	179
	○橋本次夫、佐藤詔夫、西村清彦、沼倉俊昭 (株忍足研究所)	
A - 17	液中粒子濃度測定による表面付着粒子の評価 Evaluation of Surface Contamination by Measuring Particle Transferred to Pure Water	185
	○藤井修二、湯浅和博、長南健司、渡辺高之、佐藤 泽 (東京工業大学)	
A - 18	0.1μm液中パーティクルカウンターの特性と信頼性 Reliability Characteristics and of the 0.1 μm Liquid Particle Counter	187
	○一条和夫、篠原啓介、持地秀明、新敷 茂、星名民雄 (リオン株)	
12:10~13:10	休憩	
13:10~15:10	一般講演 座長 木村昌夫 (株ダン科学)、星名民雄 (リオン株)	
A - 19	PXE法によるクリーンルーム内汚染微粒子の同定 Identification of Particles Contaminant by PIXE Analysis in Cleanrooms	191
	○渋谷幸徳、新郷 誠、平井光則 (株トヨコ地球環境研究所)	
A - 20	クリーンルーム構成材からの脱有機ガスの評価 Evaluation of organic out gases from materials of cleanroom construction	197
	○五味 弘、岡田孝夫、吉田隆紀、井上正憲、白井琢也 (高砂熱学工業株)	
A - 21	デバイス製造プロセスにおける環境制御に関する研究 その1 PXE法のクリーンルーム環境評価への適用	203

Study on Environmental Control in Device Processing

Part 1. PIXE Application to Environmental Evaluation in Clean Rooms

○呂 俊民、石黒 武、高橋幹雄、川辺綾子（㈱竹中工務店）、笠原三紀夫（慶應義塾大学）、高橋 幹二（京都大学）

A - 22	デバイス製造プロセスにおける環境制御に関する研究 その2 製造装置稼動時のクリーンルーム環境への影響 Study on Environmental Control in Device Processing Part 2. Influence of the Clean Room Environment by Process Equipment ○高橋幹雄、呂 俊民、石黒 武（㈱竹中工務店）	207
A - 23	デバイス製造プロセスにおける環境制御に関する研究 その3 スパッタプロセスにおけるコンタミネーションの評価について Study on Environmental Control in Device Processing Part 3. Evaluation of Contamination in the Sputtering Process ○石黒 武、高橋幹雄、呂 俊民、川辺綾子（㈱竹中工務店）	211
A - 24	デバイス製造プロセスにおける環境制御に関する研究 その4 RIEプロセスにおける環境評価について Study on Environmental Control in Device Processing Part 4. Evaluation of Contamination in the RIE Process ○川辺綾子、石黒 武、高橋幹雄、呂 俊民（㈱竹中工務店）	215
15:10~15:20	休憩	
15:20~17:00	一般講演 座長 榎井武一（日本工業大学）、佐藤行成（日本科学工業㈱）	
A - 25	ガス・ケミカルイオンのウェハへの影響評価と汚染対策 (その4) ケミカルガス・ミスト除去用フィルタの性能評価 Contamination of Wafer by Gases and Chemical Ions and its Control Method (No.4) Performance of Metal Fiber Filter for Gases and Mists ○大北正信、鈴木良延、梶間智明、西当修作（清水建設㈱）	219
A - 26	ガス・ケミカルイオンのウェハへの影響評価と汚染対策 (その5) ウェハに吸着する有機系ガスの分析と除去 Contamination of Wafer by Gases and Chemical Ions and its Control Method (No.5) Analysis and Removal of Adsorptive Organic Gases on Wafer ○梶間智明、鈴木良延、大北正信（清水建設㈱）	223
A - 27	イオンクロマトグラフを用いた気中アンモニアの測定法について Determination Method for Ammonia in Air by using Ionchromatography ○和泉俊彦、佐々木典令、大沼 務、齊木 篤（日立プラント建設㈱）	227
A - 28	大流量連続混合型CNCの開発と積算型静電粒径測定への応用 Development of a High Flow Rate Mixing Type CNC and Its Application to cumulative Type Electrical Aerosol Mobility Analysis ○向阪保雄、遠藤楨行、新井田亨、室谷義治（大阪府立大学）、福嶋信彦（日本科学工業㈱）	229
A - 29	クリーンルームにおけるイオン発生特性（その4） Characteristics of Ion Generation on Clean Rooms (Part 4) ○森 直樹、梅主洋一郎、佐川祐一郎、大井 亨、深尾 仁（大成建設㈱）、井深成仁、熊谷佳夫（東京 エレクトロン㈱）	237

[第2日 平成4年4月22日㈭会場(801)]

- 11:10~12:10 一般講演 座長 呂 俊民 (株竹中工務店)、内海康行 (株フジタ)
- B-15 クリーンルーム環境下の誘電体の帯電特性 241
 Charging Characteristics of Dielectric Materials in Cleanroom Environments
 ○並木則和、渋谷幸徳 (株トヨコ地球環境研究所)、通山雅貴、藤井修二 (東京工業大学)
- B-16 セラミックスエミッタの劣化に及ぼす雰囲気の効果 247
 Effects of Atmosphere on Degradation of Ceramics Emitter
 ○山本雅一、岡野一雄 (小山職業訓練短期大学校)
- B-17 APIMSによる空気イオンの組成分析 251
 APIMS Detection of Air Ions Produced by Corona Discharge in Clean Room
 ○阪田総一郎、岡田孝夫 (高砂熱学工業株)
- 12:10~13:10 休憩
- 13:10~15:10 一般講演 座長 鈴木良延 (清水建設株)、小田哲治 (東京大学)
- B-18 空気イオンバランスの自動制御 259
 Feedback Control of Air Ion Polarity Balance
 ○阪田総一郎、稲葉 仁、九嶋哲哉 (高砂熱学工業株)
- B-19 アクア・クリーンイオン化システムの開発 265
 -水による空気の清浄化-
 Development of Clean Ionization System for Ultra Clean Environment
 -Air cleaning by using pure water-
 ○鈴木政典、鈴木国夫、田中政史、山路幸郎 (株テクノ菱和)
- B-20 帯電薄膜と導体球間での高速静電気放電現象 271
 Very High Speed Electrostatic Discharge Phenomena between a Charged Insulation Film
 and a Grounded Sphers Electrode
 ○小田哲治、酒井 豊 (東京大学)
- B-21 環境における帯電微粒子(イオン)分布の測定(その5) 279
 Size Distribution Measurement of Small Charge Particles (Ions) in Atmosphere (Part 5)
 ○薩谷泰資 (イオン情報研究所)、戸谷佳武 (神戸電波株)
- B-22 先進製造現場における製品の汚染防止技術 (第二報) 281
 Isolation Techniques in Advanced Technological Manufacturing
 ○浅田敏勝 (日本アイ・ビー・エム株)
- B-23 パルスジェットによるウェハ表面の乾式洗浄 285
 Wafer Surface Cleaning by Pulse Air Jets
 ○大谷吉生、江見 準、森実哲也 (金沢大学)
- 15:10~15:20 休憩
- 15:20~16:20 一般講座 座長 川村秀夫 (株忍足研究所)、井ノ口将樹 (株朝日工業社)
- B-24 防塵衣着用作業者からの発塵機構 289
 Mechanism of Particle Contamination caused by a Worker Wearing a Cleanroom Garment
 ○柳沢重幸、中山元二、和田 健 (帝人株)
- B-25 ダスト発生解析におけるワイブル分布パラメータの推定 293
 An Estimation of the Weibull Parameter for Dust Generation Analysis
 ○竹内秀明 (NTT LSI研究所)

- B-26 クリーン洗濯系におけるクリーンルーム用衣服に付着する微生物管理についての研究 297
Microorganism Control of Clean Room Garments in Clean Laundry System
 ○浅田敏勝 (日本アイ・ビー・エム株)

[第2日 平成4年4月22日㈬C会場(904)]

11:10~12:10 一般講演	座長 鳴津和雄 (富士電機株)、向野元昭 (大成建設株)
C-16 食品用クリーンルームの室内オゾン殺菌 301 <i>Ozone Sterilization in a Biological Clean Room</i> ○高橋武男、田辺圭二、横幕博行、日下 豊 (富士電機株)
C-17 バイオロジカルクリーン手術室の空気清浄評価 (測定一その3) 305 <i>Valuation of Air Cleanliness in Biological Clean Operating Room (Measurement, Part3)</i> ○榆井武一 (日本工業大学)、樋口道雄、古山信明 (千葉大学)
C-18 空中菌サンプラーの捕集特性について (第2報) 309 <i>Collection Characteristics of Airobioscope</i> ○阿部朋子、渡辺幸吉、石森啓益、阿部帥男 (柴田科学器械工業株)
12:10~13:10 休憩	
13:10~15:10 委員会報告	座長 山路幸郎 (株テクノ菱和)、瀬田恵之 (飛島建設株)、千葉孝男 (新日本空調株)
表面洗浄技術体系調査専門委員会 311
HEPAフィルタJIS原案委員会 331
15:10~15:20 休憩	
15:20~17:40 メーカーブレゼンテーション	

뉴스

■ 올해 특정연구개발사업 확정 ■

올해 특정연구개발사업 계획이 확정됐다. 과기처는 6월 19일 오후 과기처 상황실에서 특정연구개발사업심의위원회를 열고 지난해에 비해 17.5% 늘어난 총 8백 88억원 규모의 92년도 특정연구개발사업계획을 확정했다.

과기처는 올해 특정연구개발사업비를 11개 HAN프로젝트에 우선 배정, 국책연구개발사업의 연구비를 지난해보다 1백93% 많은 4백 52억원으로 대폭 증액한 반면 첨단요소기술연구사업엔 32.8% 줄어든 3백 56억원을 배분했으며, 국제공동연구사업에 50억원, 연구기획평가사업에 30억원을 각각 배정했다.

특히 국책연구과제의 경우 △ 11개 HAN프로젝트 과제에 총 3백 80억원(7개 부처의 8백 50억원과 민간부담 8백 50억원은 별도) △ 일반국책과제에 72억원을 각각 배정하고, 첨단요소기술개발 연구사업에선 △ 국가주도 첨단요소 과제에 78억원 △ 출연연구기관 첨단요소 과제에 2백억원 △ 국공립연구소 및 정부부처산하 연구기관 과제에 17억원을 지원키로 했다.

과기처는 이와 함께 제조업경쟁력제고를 지원하기 위해 22개 산업기술연구조합과 신규사업으로 공동추진하는 신기술 지방확산 사업에 총 61억원 범위내에서 지원하고 국제공동연구과제에 50억원을 지원키로 했다.

과기처는 이밖에 목적기초연구사업에 특정연구 개발비에서 2백 90억원, 기금果實金 64억원 등 총 3백 54억원을 지원하기로 했다.